

1

# **Piezoresponse Force Microscopy (PFM)**

et

# **Dual Frequency Resonance Tracking PFM**











#### Effet piézoélectrique :

**Direct :** Contrainte mécanique = apparition d'une charge (polarisation)

**Inverse :** Application d'une tension (d'un champ électrique) et apparition d'une déformation => contraction ou allongement du matériau









3

#### **Piezoresponse Force Microscopy**

Mesure de la ferroélectricité par l'effet piézo-électrique inverse => vibration de la couche sous l'effet d'une tension alternative



Les domaines anti-parallèles vibrent en opposition de phase

![](_page_2_Picture_6.jpeg)

![](_page_3_Picture_1.jpeg)

#### out of-plane

![](_page_3_Picture_3.jpeg)

(A+B) - (C+D)

#### **Déflection verticale**

Mouvement vertical dans le sens du champ appliqué Le signal est dû au coefficient d<sub>33</sub>

![](_page_3_Picture_7.jpeg)

![](_page_3_Picture_8.jpeg)

![](_page_3_Picture_9.jpeg)

(B+D) - (A+C)

**Déflection latérale (tangage)** Mouvement de cisaillement Le signal est dû au coefficient d<sub>15</sub>

![](_page_3_Picture_12.jpeg)

![](_page_3_Picture_13.jpeg)

Tenseur piézoélectrique pour un matériau tetragonal 4mm

#### in-plane

![](_page_3_Picture_16.jpeg)

![](_page_3_Picture_17.jpeg)

### Signaux de sortie de la PFM : PFM verticale

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

![](_page_4_Figure_2.jpeg)

Echantillon : LiNb0<sub>3</sub>, V. Bornand, Montpellier

Signal PFM « mixte »

 $S_{PFM} = A_{PFM} x \cos(\varphi)$ 

Echantillon : PPLN, S. Ballandras, Besançon

![](_page_4_Picture_4.jpeg)

Idéalement : 180° entre les domaines anti-parallèles

![](_page_4_Picture_6.jpeg)

# **PFM amplitude A**<sub>PFM</sub>

Echantillon : A. Waroquet, M. Guilloux-Viry, Rennes

![](_page_4_Picture_9.jpeg)

![](_page_4_Picture_10.jpeg)

![](_page_4_Picture_12.jpeg)

On a accès à la projection du vecteur polarisation le long de l'axe z.

#### Pas de signal si :

La polarisation est dans le plan de la surface
La surface n'est pas piézo-électrique (donc pas ferroélectrique)

![](_page_5_Picture_4.jpeg)

#### Cartographie des domaines ferroélectriques

(composante perpendiculaire à la surface) : LiNbO<sub>3</sub>. On note l'excellente résolution spatiale

![](_page_5_Picture_7.jpeg)

![](_page_5_Picture_8.jpeg)

P

Ζ

![](_page_5_Picture_9.jpeg)

6

![](_page_5_Picture_10.jpeg)

![](_page_6_Picture_1.jpeg)

![](_page_6_Figure_2.jpeg)

Les domaines anti-parallèles vibrent en opposition de phase (180°) et les amplitudes de vibration sont identiques

Images : thèse d'Antoine Brugère, INSA de Lyon

![](_page_6_Picture_5.jpeg)

![](_page_6_Picture_6.jpeg)

![](_page_7_Picture_1.jpeg)

# possibilité de mesurer la composante dans le plan de la surface (in-plane) **perpendiculaire** au levier

![](_page_7_Figure_3.jpeg)

# out of-plane

![](_page_7_Picture_5.jpeg)

# in-plane

![](_page_7_Picture_7.jpeg)

![](_page_7_Figure_8.jpeg)

La composante in-plane parallèle au levier (direction x) reste inaccessible

![](_page_7_Picture_10.jpeg)

![](_page_7_Picture_11.jpeg)

# **V-PFM vs L-PFM**

![](_page_8_Picture_1.jpeg)

**Composer** les images dans et hors du plan permet de mieux connaître l'orientation de la polarisation : certains domaines apparaissent antiparallèles sur l'image PFM hors du plan de surface mais ne le sont pas.

![](_page_8_Figure_3.jpeg)

On peut forcer la polarisation à adopter une orientation précise par application d'une tension suffisante (>  $E_c$ ) entre pointe et échantillon

![](_page_9_Picture_2.jpeg)

![](_page_9_Picture_3.jpeg)

Retournement local de la polarisation (ici sur PbZrTiO<sub>3</sub> : PZT)

![](_page_9_Picture_5.jpeg)

ici sur  $Sr_2Bi_2Nb_2O_9$ : SBN)

![](_page_9_Picture_7.jpeg)

Formation PFM - DFRT, INL / INSA Lyon

![](_page_9_Picture_9.jpeg)

![](_page_10_Picture_1.jpeg)

# Possibilité de réaliser n'importe quel motif de polarisation

![](_page_10_Picture_3.jpeg)

#### **Réalisation : Antoine Brugère, CEA/LETI**

![](_page_10_Picture_5.jpeg)

![](_page_10_Picture_6.jpeg)

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

#### image 800 nm x 800 nm sur PZT

![](_page_11_Picture_3.jpeg)

Ici : taille des domaines ~ 100 nm

## Densité : ~ 2,5 Gbits / cm<sup>2</sup>

Avec 10 nm de diamètre : ~250 Gb / cm<sup>2</sup>)

Mémoires RAM no volatiles "SmartCards" : cartes d'accès à mémoire réinscriptibles...

Ce qui importe dans ces applications :

- La densité d'intégration
- La durée de vie (rémanence)

• La fatigue (nombre de cycles possibles d'écriture lecture sans perte de rémanence)

La taille des bits et leur stabilité dépend de :

- L'amplitude de la tension appliquée
- La durée de l'impulsion
- La morphologie de la surface
- L'orientation cristalline

...

![](_page_11_Figure_18.jpeg)

Université de Lille

![](_page_11_Picture_19.jpeg)

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

![](_page_12_Figure_2.jpeg)

- Plus proche des conditions macroscopiques
- Durée des paliers ajustable
- **Mais** influence de la composante électrostatique potentiellement importante si des pointes « molles » sont utilisées.

![](_page_12_Figure_6.jpeg)

**Rémanent** 

- Durée des paliers et des temps d'attente ajustables
- Pas de composante électrostatique due à l'application de la tension
- Seulement la composante rémanente de la réponse PFM est enregistrée.
- Le domaine peut éventuellement relaxer pendant le temps d'attente

![](_page_12_Picture_11.jpeg)

### **Cycles d'hysteresis locaux : exemples**

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

![](_page_13_Figure_2.jpeg)

![](_page_13_Picture_3.jpeg)

# **Cycles d'hysteresis locaux : exemple**

![](_page_14_Picture_1.jpeg)

![](_page_14_Picture_2.jpeg)

 $Sr_2Bi_2Nb_2O_9$  (SBN)

Deux orientations cristallines : (001) : orientation de la polarisation dans le plan de la surface (115) : orientation à 34°1 par rapport à la surface

B. Gautier et al. Appl. Surf. Sci. 217, 107, 2003

![](_page_14_Picture_6.jpeg)

![](_page_14_Picture_7.jpeg)

# Le mode PFM et le temps

REMISOL (In

#### Relaxation des domaines :

- En faisant l'acquisition d'images successives (lent!)
- Via un mode PFM (t) sur un point unique (pointe arrêtée)

![](_page_15_Picture_5.jpeg)

![](_page_15_Figure_6.jpeg)

A. Brugère, B. Gautier, S. Gidon, J. Appl. Phys. 110 (024102), 2011

![](_page_15_Picture_8.jpeg)

# **Dynamique des domaines : exemple**

![](_page_16_Figure_1.jpeg)

![](_page_16_Picture_2.jpeg)

Relaxation des domaines à cause d'un cycle d'hysteresis décalé sur l'axe des champs (Antoine Brugère, CEA/LETI).

![](_page_16_Figure_4.jpeg)

![](_page_16_Picture_5.jpeg)

Formation PFM - DFRT, INL / INSA Lyon

in

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

# **Quelques difficultés expérimentales**

![](_page_17_Picture_2.jpeg)

![](_page_17_Picture_3.jpeg)

![](_page_17_Picture_4.jpeg)

![](_page_18_Picture_1.jpeg)

![](_page_18_Figure_2.jpeg)

![](_page_18_Figure_3.jpeg)

- Le signal PFM parfait est en **phase** ou en **opposition de phase** avec l'excitation
- La composante Y de la détection synchrone devrait toujours être nulle
- ... Ce n'est presque jamais le cas !
- Il existe un bruit inhérent à la mesure (couplages capacitifs, vibrations, électronique....)
- Amplitude différente pour les domaines opposés
- => Différence de phase différente de 180°

![](_page_18_Figure_10.jpeg)

![](_page_18_Picture_11.jpeg)

## Choix de la fréquence de travail

REMISOL (inl

![](_page_19_Figure_2.jpeg)

![](_page_19_Picture_3.jpeg)

Formation PFM - DFRT, INL / INSA Lyon

![](_page_20_Picture_1.jpeg)

![](_page_20_Figure_2.jpeg)

![](_page_20_Figure_3.jpeg)

![](_page_20_Figure_4.jpeg)

FIG. 17. (Color online) (a) Bias dependence of the lithium concentration change for ideal linear case (dashed line) and in the presence of limiting electrochemical reaction stage (solid curve). (b) Expected shape of the ESM hysteresis loops.

Morozovska et al., J. Appl. Phys. 108, 053712, 2010 and Appl. Phys. Lett. 96, 222906, 2010

Variation de volume molaire sous la pointe due à la mobilité ionique

![](_page_20_Picture_8.jpeg)

Lacunes d'oxygène

![](_page_20_Picture_10.jpeg)

REMISOL (inl

Une couche d'eau est toujours présente sur la surface et forme un ménisque sur la pointe

On peut utiliser cette couche d'eau intentionnellement pour faire de la nanooxydation

**Exemple :** le silicium s'oxyde très bien si on applique une tension positive sur le substrat.

![](_page_21_Figure_5.jpeg)

Weeks et al., Langmuir 21, 8096 (2005)

![](_page_21_Figure_7.jpeg)

![](_page_21_Figure_8.jpeg)

![](_page_21_Picture_9.jpeg)

![](_page_21_Figure_10.jpeg)

![](_page_21_Picture_11.jpeg)

## Influence de la couche d'eau sur les domaines

![](_page_22_Picture_1.jpeg)

![](_page_22_Figure_2.jpeg)

![](_page_22_Picture_3.jpeg)

![](_page_22_Picture_4.jpeg)

En atmosphère contrôlée (Dimension 3100 : A. Nowodzinski, CEA Grenoble)

![](_page_22_Figure_6.jpeg)

![](_page_22_Figure_7.jpeg)

Simulation entièrement électrique de la propagation des domaines sur LiTaO<sub>3</sub>

![](_page_22_Picture_9.jpeg)

![](_page_22_Picture_10.jpeg)

La présence de l'eau change les conditions de compensation de la charge de polarisation. Il n'est pas étonnant qu'elle ait un rôle sur leur stabilité

Domaine de 1.5 µm de côté sur LiTaO<sub>3</sub>

Image PFM sur une heure de temps : le domaine est très stable

Introduction de l'eau dans l'enceinte : le domaine retourne à sa polarisation initiale

![](_page_23_Figure_5.jpeg)

Kalinin *et al.*, J. Appl. Phys. **91**, 3816 (2002), Kim *et al.*, Appl. Phys. Lett. **94**, 032907 (2009) Liu *et al.*, Appl. Phys. Lett. **89**, 132905 (2006)

![](_page_23_Figure_7.jpeg)

A. Brugère, non publié

![](_page_23_Picture_9.jpeg)

### Attention aux couches très minces !

![](_page_24_Figure_1.jpeg)

![](_page_24_Figure_2.jpeg)

![](_page_24_Picture_3.jpeg)

R. Arinero et al. J. Appl. Phys.110 (014304), 2011,

W. Hourani et al. J. Vac. Sci. Technol. B 29, 01AA06, 2011

A. Grandfond et al. J. Appl. Phys. **115**, 134103 (2014)

![](_page_24_Picture_7.jpeg)

![](_page_24_Figure_8.jpeg)

In air

 $H_2O$ 

 $SiO_2$ 

+

 $H^+$ 

Silicon

\_

 $OH^{-}$ 

![](_page_24_Picture_10.jpeg)

![](_page_24_Picture_11.jpeg)

mBar)

Surface degradation

after poling of a PZT

(from : Kalinin et al.,

ACS Nano 5(7):5683,

surface

2011)

![](_page_24_Picture_13.jpeg)

![](_page_24_Figure_14.jpeg)

Vacuum + heating stage

Non spécifique au silicium

![](_page_24_Picture_17.jpeg)

![](_page_24_Picture_18.jpeg)

![](_page_24_Picture_19.jpeg)

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

Pourquoi changer de fréquence ?

![](_page_25_Picture_2.jpeg)

![](_page_25_Picture_3.jpeg)

![](_page_25_Picture_4.jpeg)

# **Piezoresponse Force Microscopy (PFM)**

Le levier vu comme un oscillateur harmonique

Fréquence de résonance de contact  $f_0 \sim 4.4 f_{libre}$ U. Rabe, Acoustic Force Acoustic Microscopy. In B. Bhushan & H. Fuchs (Eds.), Applied Scanning Probe Methods II (Vol. 2, pp. 65). Germany: Springer

Levier EFM classique,  $\rm f_{libre} \sim~75~kHz$  =>  $\rm f_{0} \sim 330~kHz$ 

#### Fréquence de travail loin de la fréquence de résonance :

Réduit l'influence de la topographie sur le signal PFM

MAIS si le coefficient piézoélectrique est trop faible :

• Le rapport signal sur bruit peut être très faible (surtout si le coefficient piézoélectrique est faible) et le bruit gêner les interprétations des signaux PFM (voir l'influence du bruit décrite précédemment)

• Les tensions appliquées pour avoir du signal peuvent être très (trop) fortes : dommages dans le matériau, déformation du cycle d'hysteresis

Néanmoins, travailler à basse fréquence est une méthode fiable. C'est la probablement la meilleure façon de procéder si le coefficient piézoélectrique est suffisamment fort.

![](_page_26_Picture_10.jpeg)

![](_page_26_Picture_11.jpeg)

![](_page_26_Figure_12.jpeg)

![](_page_26_Picture_13.jpeg)

# Pourquoi faire de la DART / DFRT ?

### Travailler proche de la fréquence de résonance

• Rapport signal sur bruit meilleur (multiplié par le coefficient de qualité)

 Permet d'imager des échantillons qui resteraient dans le bruit en PFM basse fréquence

#### MAIS :

• Le coefficient de qualité est inconnu et change d'un point à l'autre (il faut dire adieu à toute possibilité de quantification du signal PFM)

• La fréquence de résonance de contact est très dépendante des conditions de contact : rugosité, frottement, manière dont la pointe est « attachée » à la surface, etc

#### •La fréquence de résonance peut se décaler pour tout un tas de raison dont certaines sont peu maîtrisables

- => Grande influence de la topographie sur le signal PFM.
- Attention à l'interprétation des images PFM !

![](_page_27_Figure_10.jpeg)

Driving At the Contact Resonance - Smooth surface

![](_page_27_Figure_12.jpeg)

![](_page_27_Figure_13.jpeg)

![](_page_27_Figure_14.jpeg)

![](_page_27_Figure_15.jpeg)

28

![](_page_27_Picture_16.jpeg)

Applications/PFMAppNote/PFMAppNote.shtml

Source : Asylum Research http://www.asylumresearch.com/

![](_page_28_Picture_1.jpeg)

Gênant aussi : la phase peut tourner de 180° sur une plage de fréquence assez faible => souci potentiel pour les cycles d'hysteresis

• Le signal PFM est amplifié par la résonance de contact du levier : même excitation, réponse Q fois plus forte en comparaison du mode basse fréquence

• Si la fréquence de résonance shifte, alors le cantilever excité à une fréquence fixe ne répond plus

• => Le signal PFM varie mais pas parce que les propriétés piézoélectriques d<sub>22</sub> ont varié, mais parce que les propriétés de contact de la surface ont varié

![](_page_28_Figure_6.jpeg)

B. J. Rodriguez, C. Callahan, S. Kalinin, and R. Proksch, Dual-frequency resonance-tracking atomic force microscopy. Nanotechnology 18, 475504 (2007).

![](_page_28_Picture_8.jpeg)

# **Exemple d'artefacts**

IYON

![](_page_29_Picture_1.jpeg)

![](_page_29_Figure_2.jpeg)

# **PFM sur SiO**<sub>2</sub>

3 nm d'épaisseur sur Si

- Image PFM proche de la fréquence de résonance (resonance enhanced PFM)
- Légère modification topographique sur la surface

• => Effet des charges déposées sur la surface et déplacement de la fréquence de résonance sous l'action de la force de Coulomb ?

• => Injection de charges dans le volume et effet de la force coulombienne sur la fréquence de résonance de contact ?

• => Phénomène électrochimique ?

![](_page_29_Figure_10.jpeg)

Cycle d'hysteresis in field inversé, forte influence probable de la composante électrostatique

Signal très faible en basse fréquence

![](_page_29_Picture_13.jpeg)

![](_page_29_Picture_14.jpeg)

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

### **DFRT PFM :**

maîtriser les artefacts dus à la mobilité de la fréquence de résonance

![](_page_30_Picture_3.jpeg)

![](_page_30_Picture_4.jpeg)

# **DFRT PFM : principle**

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

- Le cantilever est excité à deux fréquences distinctes de part et d'autre de la fréquence de résonance
- La détection synchrone mesure les deux amplitudes en même temps
- La différence entre les deux amplitudes est gardée **constante** en déplaçant les fréquences d'excitation.

- Pour éviter les artefacts, il faut suivre la fréquence de résonance quand elle varie, donc changer la fréquence d'excitation
- On ne peut pas le faire en régulant la phase de la réponse du levier (avec une PLL) à cause du brusque changement de 180° entre deux domaines, impossible à réguler. Donc on ne peut pas utiliser une seule fréquence

![](_page_31_Figure_7.jpeg)

![](_page_31_Picture_8.jpeg)

- Necessite une détection synchrone double entrée (mesure indépendante de deux signaux en même temps), « haute fréquence » (mesure à 300-500 kHz, alors que beaucoup de DS standards coupent à 100 kHz).
- On génère une porteuse de fréquence égale à la fréquence de résonance : f<sub>P</sub>
- La porteuse est modulée par un signal basse fréquence => f<sub>M</sub>
- On applique la tension résultante entre la pointe et l'échantillon : on a donc bien une excitation symétrique par rapport à la fréquence de résonance
- On mesure les amplitudes à  $f_P + f_M$  et  $f_P f_M = > A^+$  et  $A^-$
- On régule sur la différence entre les deux amplitudes A<sup>+</sup> et A<sup>-</sup>

![](_page_32_Figure_7.jpeg)

![](_page_32_Figure_8.jpeg)

Note : la moitié de l'énergie du signal modulé se trouve dans le satellite de gauche, l'autre moitié dans le satellite de droite

![](_page_32_Picture_10.jpeg)

## **DFRT : Schéma simplifié de principe**

![](_page_33_Figure_1.jpeg)

![](_page_33_Picture_2.jpeg)

![](_page_33_Picture_5.jpeg)